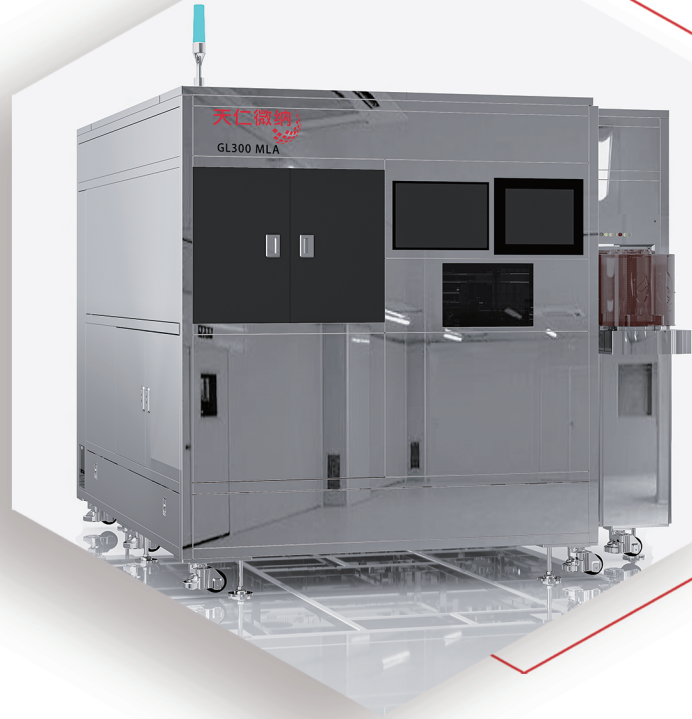


## 设备简介

GL300 MLA是天仁微纳最新型专门为晶圆级光学加工（WLO-Wafer Level Optics）开发的全自动紫外纳米压印设备，可在200/300 mm基底面积上平行复制生产聚合物光学器件。

该设备支持cassette to cassette自动上下片、自动复制柔性复合工作模具，工作模具自动更换。整个工艺过程在密闭洁净环境中进行，以保证压印结果质量。内置的高精度自动点胶系统、APC（主动模具基底平行控制）技术、以及自动脱模功能都保证了大面积晶圆级光学生产的精度、均匀性（TTV）与良率。同时，自动模具基底对位系统还可实现晶圆之间对位堆叠工艺（WLS-Wafer Level Stacking）。

GL300 MLA纳米压印设备适用于DOE、匀光片（Diffuser）、微透镜阵列、菲涅尔透镜等产品的研发和量产。



# GL300 MLA

## 200/300mm WLO工艺量产型紫外纳米压印光刻设备 晶圆级光学器件加工（WLO）

### 设备参数

兼容基底尺寸	200mm、300mm，特殊尺寸可定制
支持基底材料	硅片、玻璃、石英、塑料、金属等
上下片方式	Cassette to cassette全自动上下片
晶圆预对位	光学巡边预对位
纳米压印技术	APC主动平行控制技术，适合大面积WLO、WLS等工艺
压印精度	可小于10nm*
结构深宽比	优于10:1
TTV控制	微米级精度（200 /300 mm晶圆）
紫外固化光源	紫外LED（365nm）面光源，光强>1000mW/cm <sup>2</sup>
	水冷冷却（2000mW/cm <sup>2</sup> 类型光源可选配）
设备内部环境	标配，外部环境Class 100
控制	内部环境可达Class 10*
自动压印	支持
自动脱模	支持
自动工作模具复制	支持
自动工作模具更换	支持
模具基底对位	自动对位（选配）
功能	

\*参数取决于模具、材料、工艺和使用环境，非设备极限

\*天仁微纳保留对信息的解释权

### 主要功能

- 全自动200/300mm晶圆级光学加工（WLO）生产线
- APC主动模具基底平行控制技术，确保大面积晶圆压印TTV均匀性
- Cassette to cassette自动上下片，光学巡边预对位
- 设备内自动复制柔性复合工作模具，同时支持自动更换工作模具，适合连续生产
- 内置高精度自动点胶功能
- 自动对位、自动压印、自动曝光固化、自动脱模，工艺过程在密闭洁净环境中自动进行，以保证压印质量
- 标配高功率紫外LED面光源（365nm，光强>1000mW/cm<sup>2</sup>），水冷冷却，特殊功率以及特殊、混合波长光源可订制，完美支持各种商用纳米压印材料
- 随机提供全套纳米压印工艺与材料，包括标准示范WLO等工艺流程，帮助客户零门槛达到国际领先的纳米压印水平

OUR CONTACT!

GermanLitho GmbH  
Göttschlag 6b  
85391 Allershausen Germany  
Tel: +49 (0) 8166 6999069  
Fax: +49 (0) 8166 9987619  
E-mail: contact@germanlitho.com

### 联系方式

青岛天仁微纳科技有限责任公司  
青岛市城阳区祥阳路106号-青岛未来科技产业园6号楼  
电话: 0532-67769322  
传真: 0532-67768286  
电子邮件: contact@germanlitho.com  
网址: www.germanlitho.com